

(Taiwan)

EV Group Hybrid Bonding and Nanoimprint Lithography Solutions to be Highlighted at SEMICON **TAIWAN 2023 - September 6, 2023**

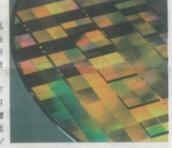
EVG在SEMICON Taiwan 2023 展示混合鍵合與奈米微影壓印解決方案

在SEMICON Taiwan 2023國際半導體展中。 EV Group (EVG)將重點介紹由該公司先進之品 圓到晶圓 (W2W) 與晶粒到晶圓 (D2W) 混合 鍵合、檢測與奈米微影壓印 (NIL) 解決方案所 帶來的3D集成和異質整合與擴增實境(AR)波 導製造領域的全新發展。

EVG在2023年的展會論壇上將深入探討以下 主題:首先,在「微機電暨感測器論壇」(9月 5日、週二下午2點、台北南港展覽館一館5樓 505ab室)·EVG將分享奈米微影壓印的多功能 性與最新成就,並聚焦於超穎透鏡和擴增實境/ 虚擬實境技術的製造。以及這項技術能力的迅速 EVG-D2W屬校到暴興。

其次,在「TechXPOT」(9月6日,週三下午2 EVG的晶圓接合、微影與檢測解決方案,使 從昌粒到晶圓、晶圓到晶圓,以及新型封裝技術 能。 的無光單曝光設備。

最後,在「異質整合國際高峰論壇」上(9月8 歡迎蒞隆SEMICON Talwan 2023國際半導體展 日,週五下午2:20·台北南港展覽館一館4樓401 金觀EVG攤位L0316 (一館4樓),以獲取更多 室)·EVG將討論晶圓到晶圓和晶粒到晶圓混合 相關資訊。 接合的當前產業趨勢和技術進展,包括關鍵的技



術差異和整合場景。

點,台北南港展覽館一館4樓L1100攤位),EVG 得先進封裝、微機電系統(MEMS)與化合物半導 將介紹目前各種應用中對堆疊層計量要求,涵蓋 體等領域中技術創新的開發和大規模製造成為可

中的晶粒位移的困擾等,例如具有適應性圖案化 EVG在異質整合和晶片級封裝方面的技術領導 地位包括:混合鍵合技術應對3D裝置整合;晶圓 此外,在「半導體先進製程科技論壇」中(9 接合對準技術應對未來3D-IC封裝需求的;紅外 月8日,週五下午2點,台北南港展覽館一館4樓 線雷射釋放技術消除先進封裝中的玻璃基板並實 402室),EVG將對次世代記憶體和邏輯裝置相_、現薄層3D堆疊;無光單曝光技術應用於扇出成型 關的當前產業趨勢進行分享,重點聚無3D集成如 晶圓級封裝 (FOWLP) ; 以及奈米微影壓印技 術支援晶片級光學元件(WLO)製造。

